ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ

2. Примесные полупроводники

1.4. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В ПОЛУПРОВОДНИКАХ

* Каждый электрон, входящий в состав атома, обладает определенной энергией или занимает определенный энергетический уровень.

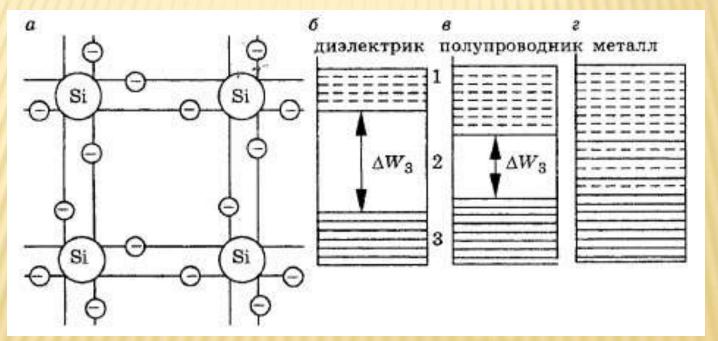
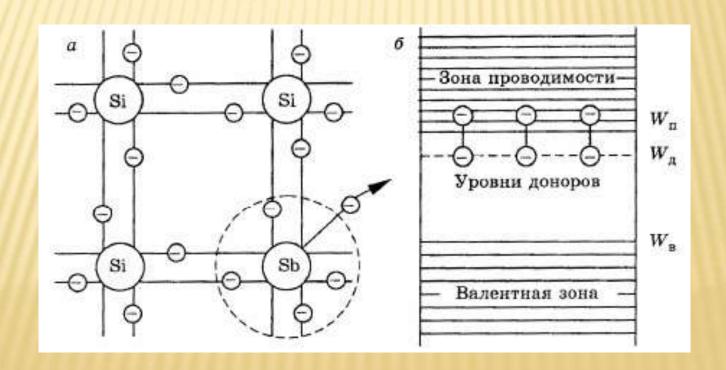


Рисунок 1 – Структура связей атомов кремния и условное обозначение электрических зон

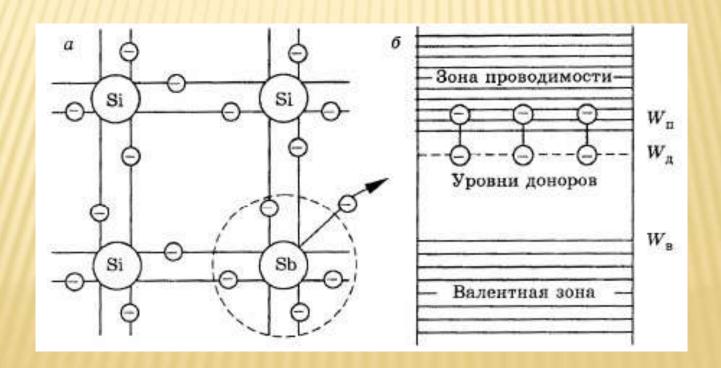
2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

- * Если в кристалл германия или кремния добавить примесь элементов третьей или пятой групп таблицы Менделеева, то такой полупроводник называется примесным. Примеси могут быть донорного и акцепторного типа.
- Примесный атом, создающий в запрещенной зоне энергетический уровень, занятый в невозбужденном состоянии электронами и отдающий в возбужденном состоянии электрон в зону проводимости, называют донором.
- Примесный атом, создающий в запрещенной зоне энергетический уровень свободный от электронов в невозбужденном состоянии и способный захватить электрон из валентной зоны при возбуждении, создавая дырки в валентной зоне, называют акцептором.

* При внесении в предварительно очищенный кремний, германий примеси пятивалентного элемента – донора (фосфор Р, сурьма Sb, мышьяк As) атомы примеси замещают основные атомы в узлах кристаллической решетки (см. рис. 2a).



 При этом четыре из пяти валентных электронов атома примеси образуют ковалентные связи с четырьмя соседними атомами полупроводника. Пятый электрон оказывается избыточным.



- Энергия ионизации донорных атомов значительно меньше энергии ионизации собственных полупроводников. Поэтому при комнатной температуре избыточные электроны примеси возбуждаются и переходят в зону проводимости.
- * Атомы примесей, потерявшие избыточный электрон, становятся положительными ионами. Количество электронов $N_{\rm Д}$, переходящих под действием тепловой энергии в зону проводимости с донорного уровня $W_{\rm Д}$, значительно превышает количество электронов n_i , переходящих в зону проводимости из валентной зоны в процессе генерации пар электрон-дырка.

* Можно считать, что концентрация электронов проводимости полностью определяется концентрацией донорной примеси $n_n \approx N_{\text{Д}}$, а концентрация дырок составляет

$$p_n = rac{n_i^2}{n_n} = rac{n_i^2}{N_{ot}}$$

- * Концентрация дырок в донорном полупроводнике значительно ниже, чем в собственном полупроводнике. В связи с этим дырки p_n являются неосновными носителями, а электроны n_n основными носителями.
- Поэтому донорный полупроводник называется
 электронным полупроводником или полупроводником *п*-типа.

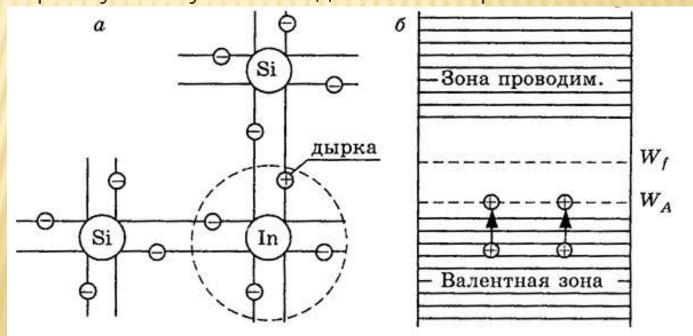
При этом меняется положение уровня Ферми

$$\times W_{Fn} = \frac{W_c + W_n}{2} - \frac{kT}{2} \ln \frac{2N_c}{N_{\perp}}$$

- $strule N_c$ эффективная плотность состояний в зоне проводимости W_n донорный уровень
- С повышением температуры донорный уровень смещается к середине запрещённой зоны.

а — б б — Зона проводим. — W_f — W_A — Валентная зона — Валентная — Валентная зона — Валентная зона — Валентная — Валентная зона — Валентная —

- Достаточно небольшой внешней энергии, чтобы электроны из верхних уровней валентной зоны переместились на уровень примеси, образовав недостающие ковалентные связи (см. рис. 36).
- При этом в валентной зоне появляются избыточные уровни (дырки), которые участвуют в создании электрического тока.



- За счет ионизации атомов исходного материала из валентной зоны часть электронов попадают в зону проводимости.
- Число дырок в акцепторном полупроводнике превышает число электронов

$$n_p = \frac{p_i^2}{p_p} = \frac{p_i^2}{N_A}$$

- $m{ iny L}$ Дырки $m{p}_{m{p}}$ являются основными носителями, а электроны $m{n}_{m{p}}$ неосновными носителями.
- Полупроводники с акцепторной примесью носят название дырочных или полупроводников **р-типа**.

При этом меняется положение уровня Ферми

$$\times W_{Fp} = \frac{W_{\rm B} + W_p}{2} + \frac{kT}{2} \ln \frac{2N_{\rm B}}{N_{\rm A}}$$

- $m{\times}$ где $N_{
 m B}$ эффективная плотность состояний в валентной зоне $W_{
 m p}$ акцепторный уровень
- **«** С повышением температуры акцепторный уровень смещается к середине запрещённой зоны.

2.2. НЕРАВНОВЕСНЫЕ НОСИТЕЛИ

- Под влиянием различных энергетических воздействий в полупроводнике может возникнуть неравновесная концентрация зарядов. Образование неравновесных (избыточных) носителей заряда может происходить при освещении полупроводника, в результате чего появляются дополнительные электронно-дырочные пары.
- В полупроводниковых диодах и транзисторах при прохождении тока образуются неравновесные носители заряда.
- Процесс рекомбинации электронов и дырок может происходить либо прямым путём – из зоны в зону, либо через локальные энергетические уровни в запрещённой зоне, называемые центрами рекомбинации, или ловушками

<u>№ При наличии электрического поля</u> на хаотическое движение электронов и дырок накладывается компонента направленного движения. В результате электроны и дырки начинают перемещаться – возникает дрейфовый ток. Плотность дрейфового тока пропорциональна концентрации носителей, подвижности и напряжённости поля *E*:

$$j_{n \text{ др}} = en\mu_n E$$

 $j_{p \text{ др}} = ep\mu_p E$

imes где μ_n , μ_p - подвижность электронов и дырок соот-но.

st Суммарная плотность дрейфового тока $j_{
m дp}$ равна:

$$j_{\text{др}} = e(n\mu_n + p\mu_p)E = \sigma E$$
$$\sigma = e(n\mu_n + p\mu_p)$$

где **σ** – удельная электрическая проводимость полупроводника, См/см.

- \star У германия $\mu_n = 3900 \frac{\text{см}^2}{\text{B} \cdot \text{c}}$, $\mu_p = 1900 \frac{\text{см}^2}{\text{B} \cdot \text{c}}$
- \star У кремния $\mu_n=1500rac{ ext{cm}^2}{ ext{B}\cdot ext{c}}$, $\mu_p=450rac{ ext{cm}^2}{ ext{B}\cdot ext{c}}$

- При низкой температуре концентрация электронов и дырок определяется в основном концентрацией примеси и слабо зависит от температуры. С ростом температуры удельная проводимость несколько уменьшается за счёт уменьшения подвижности носителей заряда.
- При высокой температуре начинается ионизация собственных атомов полупроводника, поэтому концентрация носителей, а следовательно, и проводимость полупроводника возрастает.
- При прохождении дрейфового тока через однородный полупроводник концентрация носителей заряда в любом элементарном объёме остаётся постоянной.

★ Если концентрация подвижных носителей в различных точках неодинакова, в полупроводнике в соответствии с законами теплового движения возникает диффузия частиц из области с большей их концентрацией в область с меньшей концентрацией. В результате этого в полупроводнике возникает электрический ток, обусловленный градиентом (перепадом) концентрации носителей, называемый диффузионным током.

Плотность диффузионного тока в одномерном случае

$$j_{n\,\mathrm{диф}} = -eD_n rac{dn}{dx}$$
 $j_{p\,\mathrm{диф}} = -eD_p rac{dp}{dx}$

- f x где D_n , D_p коэффициент диффузии электронов и дырок соот-но
 - $\frac{dn}{dx}$, $\frac{dp}{dx}$ градиенты концентрации
- Принято считать, что диффузионный ток направлен в сторону увеличения концентрации электронов, поэтому он берётся с положительным знаком.

В полупроводнике могут существовать и электрическое поле, и градиент концентрации носителей заряда. Тогда ток в полупроводнике будет иметь как дрейфовую, так и диффузионную составляющие:

 Параметры дрейфового и диффузионного токов связаны между собой соотношениями Эйнштейна:

$$\mathbf{x}$$
 $D_n = \frac{kT}{e} \mu_n$ $D_p = \frac{kT}{e} \mu_p$ где $\frac{kT}{e}$ - тепловой потенциал

2.4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕХОДЫ

- Электрическим переходом называется переходный слой между областями твёрдого тела с различными типами или значениями проводимости.
- * Чаще всего используется электрический переход между полупроводниками n- и p-типа, называемый электроннодырочным переходом, или p-n-переходом.
- Используются также переходы между областями с одинаковым типом электропроводности, но с различными значениями удельной проводимости (n+-n; p+-p). Знак «+» отмечает область с большей концентрацией примеси.
- Широкое применение получили переходы металлполупроводник. Электрические переходы металл-полупроводник формируются вакуумным напылением тонкой металлической пленки на очищенную поверхность полупроводника.

2.4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕХОДЫ

- * Электрические переходы могут создаваться как на основе полупроводников с одинаковой шириной запрещённой зоны (гомопереходы), так и с различными значениями ширины (гетеропереходы).
- * Концентрации основных носителей заряда в p-n переходе могут быть равны или значительно различаться. Электронно-дырочный переход, у которого $n_n \cong p_p$ называется симметричным.
- Если концентрация основных носителей заряда в областях различны и отличаются на два-три порядка, то p-n переходы называют несимметричными. Несимметричные переходы на практике используются чаще, чем симметричные.

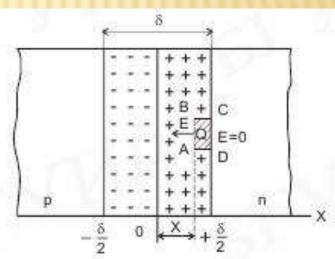
2.4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕХОДЫ

- В зависимости от характера распределения примесей различают две разновидности переходов: резкий (ступенчатый) и плавный.
- В резком переходе концентрации примесей на границе раздела областей изменяются на расстоянии, соизмеримом с диффузионной длиной, а в плавном – на расстоянии, значительно большем диффузионной длины.
- Электрические переходы используются практически во всех полупроводниковых приборах. Физические процессы в переходах лежат в основе действия большинства полупроводниковых приборов.

- * Равновесие соответствует нулевому внешнему напряжению на переходе. Т.к. концентрация электронов в n-области значительно больше, чем в p-области, а концентрация дырок в p-области больше, чем в n-области, то на границе раздела полупроводников возникает градиент концентрации подвижных носителей заряда $\frac{dn}{dx}$, $\frac{dp}{dx}$.
- Вследствие этого заряды будут диффундировать из области с большей концентрацией в область с меньшей концентрацией, что приведёт к появлению диффузионного тока электронов и дырок, плотность которых равна:

$$x$$
 $j_{n \text{ диф}} = eD_n \frac{dn}{dx}$ $j_{p \text{ диф}} = -eD_p \frac{dp}{dx}$

На границе р- и n-областей создаётся слой, обеднённый подвижными носителями. В приконтактной области n-типа появляется нескомпенсированный заряд положительных ионов, а в дырочной области – нескомпенсированный заряд отрицательных ионов примесей. Таким образом, электронный полупроводник заряжается положительно, а дырочный – отрицательно.



- * Между областями полупроводника с различными типами электропроводности возникает электрическое поле напряжённостью E. Образовавшийся двойной слой электрических зарядов называется запирающим, он обеднён основными носителями и имеет вследствие этого низкую электропроводность.
- Вектор напряженности поля направлен так, что он препятствует диффузионному движению основных носителей и ускоряет неосновные носители. Этому полю соответствует контактная разность потенциалов ф_k, связанная с взаимной диффузией носителей. За пределами р-n-перехода полупроводниковые области остаются нейтральными.

- * Движение неосновных носителей образует дрейфовый ток, направленный навстречу диффузионному току.
- Итак, в условиях равновесия встречные дрейфовый и диффузионный токи должны быть равны, т.е.

$$j_{\text{диф}} + j_{\text{др}} = 0$$

 Определим выражение контактной разности потенциалов, подставив выражения дрейфового и диффузионного токов:

$$* ep\mu_p E - eD_p \frac{dp}{dx} = 0, E = \frac{dU}{dx}$$

Следовательно

$$-ep\mu_p \frac{dU}{dx} - eD_p \frac{dp}{dx} = 0$$
 или $dU = -\frac{D_p}{\mu_p} \frac{dp}{p}$

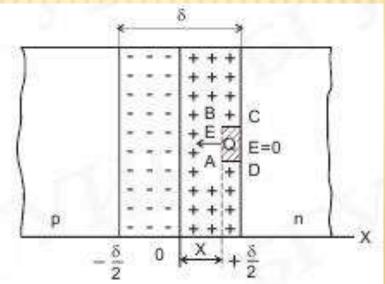
Используя соотношения Эйнштейна, запишем

$$dU = -\frac{kT}{e} \frac{dp}{p}$$

$$\mathbf{x}$$
 Тогда $U_k = -\frac{kT}{e} \ln p + C$

- \star Постоянную интегрирования C найдём введя краевые условия:
- * в р-области потенциал $U=\varphi_p$, концентрация дырок $p=p_p$; в n-области $U=\varphi_n$ и $p=p_n$.
- pprox Тогда выражение для контактной разности потенциалов $arphi_k$ в p-n-переходе:

* Рассмотрим распределение зарядов и электрического поля в условиях равновесия в плоско-параллельном переходе, имеющем одинаковую концентрацию доноров и акцепторов во всём объеме $N_A = N_A$ и резкое изменение типа проводимости на границе р- и n-областей



используя выражение

$$U_k = -\frac{kT}{e} \ln p + C$$

и полагая $U_k = \varphi_p$ при $p = p_p$ найдём концентрацию носителей в переходе

Аналогичным образом получим

flux С ростом потенциала $m{U}_k$ концентрация дырок и электронов быстро убывает. Вдали от перехода концентрация электронов и дырок одинакова и определяется условием нейтральности объема полупроводника

$$\times p_p - n_p - N_A = 0$$

$$\mathbf{x} - p_n + n_n + \mathbf{N}_{\mathbf{A}} = 0$$

Воспользовавшись теоремой Остроградского – Гаусса,
 можно найти распределение поля в переходе:

$$\mathbf{x} E = \frac{N \cdot e \ (\frac{\delta}{2} - x)}{\varepsilon}$$
 при $x > 0$

$$\mathbf{x} \; E = \frac{N \cdot e \; (\frac{\delta}{2} + x)}{\varepsilon}$$
 при $x < 0$

* Электрическое поле в переходе линейно возрастает от нуля на границе перехода до максимального значения в середине перехода, т.е. при x=0

$$\star E = \frac{N \cdot e \cdot \delta}{2\varepsilon}$$

 \mathbf{x} Толщину перехода можно определить как $\delta/2$

$$\int_{0}^{\delta/2} E dx = \frac{\varphi_k}{2}$$

Подставив в предыдущее выражение получим

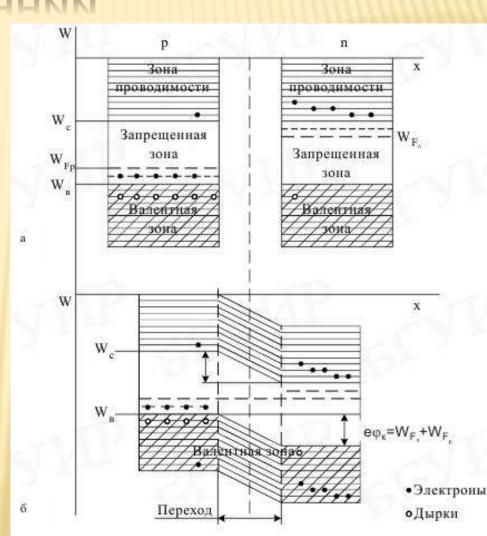
$$\delta = \sqrt{\frac{4\varepsilon}{e \cdot N}} \varphi_k$$

- Если концентрация примеси в р- и n-областях различна, то и глубина проникновения перехода в р-и n-области будет неодинакова, т.к. нескомпенсированный заряд в обеих частях должен быть одинаковым.
- **ж** Большую толщину переход имеет в областях с меньшей концентрацией примеси.

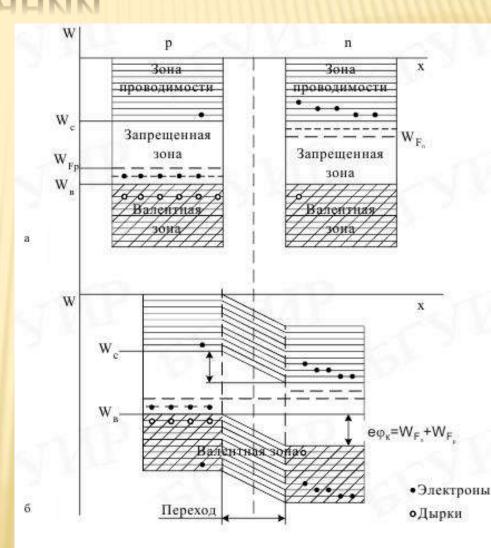
Суммарная толщина перехода в этом случае определится

$$\delta = \sqrt{\frac{2\varepsilon\varphi_k}{e}(\frac{1}{N_{\rm A}} + \frac{1}{N_{\rm A}})}$$

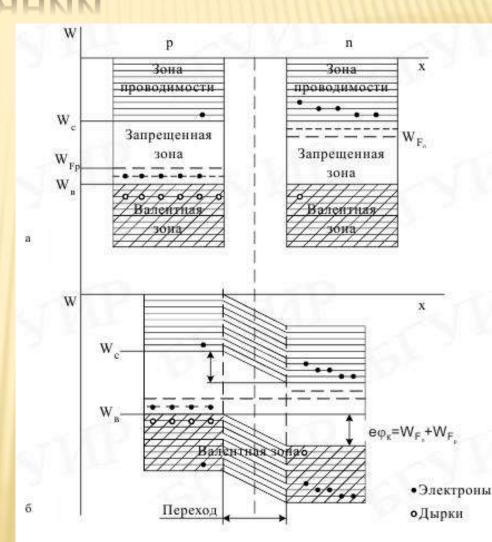
- На рисунке показана энергетическая диаграмма р-n структуры.
- Так как величина энергии уровня Ферми должна быть одинаковой по всей структуре, уровень Ферми располагается на одной высоте.



В области p-n-перехода энергетические уровни имеют наклон, что свидетельствует о наличии градиента потенциала, а следовательно, и электрического поля, выталкивающего подвижные заряды из перехода.



- Разность минимальных значений энергии в зонах проводимости р- и n-областей определяется контактной разностью потенциалов.
- Чтобы перейти
 в валентную зону
 п-области, дырки
 должны совершить работу,
 равную e · φ_k.

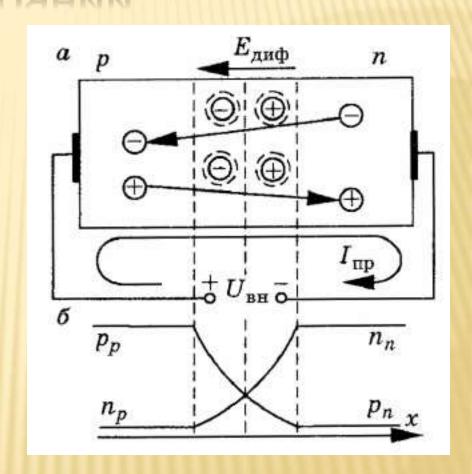


- При подключении к p-n переходу внешнего электрического поля динамическое равновесие токов нарушается.
- Поведение р-п перехода зависит при этом от полярности приложенного напряжения.
- Если внешнее напряжение приложено навстречу контактной разности

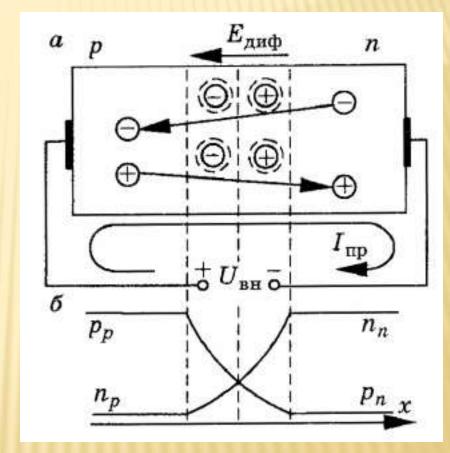
прямым (см. рис. а).



- Внешнее (прямое)
 напряжение почти полностью
 падает на p-n переходе,
 сопротивление которого во
 много раз выше
 сопротивления
 р- и n-областей.
- f x С увеличением прямого напряжения высота потенциального барьера уменьшается $U_1=U_k-U_{
 m пр}$



- Основные носители областей полупроводника, приближаясь к p−n переходу, частично компенсируют объемные пространственные заряды, уменьшая тем самым ширину запирающего слоя и его сопротивление (см. рис. б).
- В цепи протекает
 электрический ток,
 при этом диффузионная
 составляющая тока через



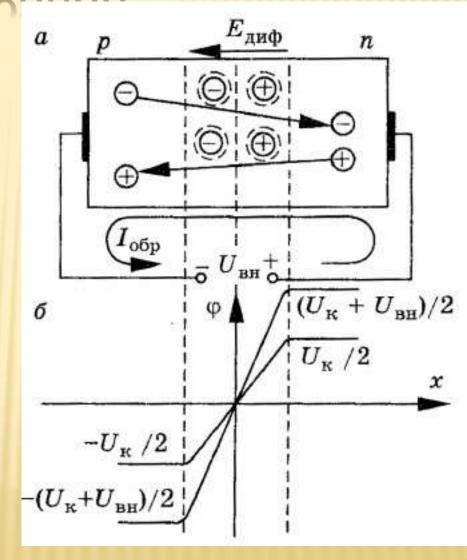
составляющая тока через переход увеличивается, а дрейфовая – уменьшается.

- $f \times$ При $U_k = U_{\pi p}$ толщина p-n-перехода стремится к нулю и при дальнейшем увеличении $U_{\pi p}$ запирающий слой исчезает. Вследствие чего электроны и дырки (основные носители заряда в n- и p-областях) начинают свободно диффундировать в смежные области полупроводника.
- Увеличение диффузионной составляющей тока через p-n
 переход при неизменной дрейфовой составляющей приводит
 к нарушению термодинамического равновесия и через переход
 протекает ток, который называется прямым.
- \mathbf{x} $j = j_{\text{диф}} + j_{\text{др}} \neq 0$

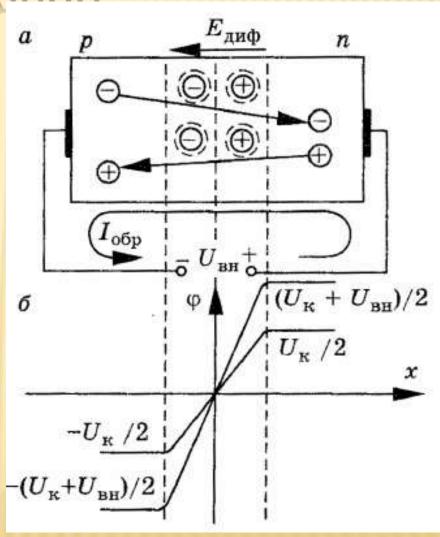
- Процесс переноса носителей заряда через прямосмещенный электронно-дырочный переход в область полупроводника, где они становятся неосновными носителями, называется инжекцией.
- В несимметричном p-n переходе, когда концентрация электронов в n-области во много раз больше концентрации дырок в p-области, диффузионный поток электронов во много раз превышает поток дырок и ими можно пренебречь.
- В данном случае имеет место односторонняя инжекция электронов.
 Область, из которой происходит инжекция, называют эмиттером, а область, в которую инжектируются носители базой.

- Неравновесные неосновные носители зарядов диффундируют вглубь полупроводника и нарушают его электронейтральность.
- Восстановление электронейтральности происходит за счет поступления носителей заряда от внешнего источника взамен ушедших к p-n переходу и исчезнувших в результате рекомбинации.
 Это приводит к появлению электрического тока во внешней цепи прямого тока.

- № При обратном включении р-п перехода внешнее напряжение приложено знаком "плюс" к п-области (см. рис. а).
- Создаваемое им
 электрическое поле
 совпадает по направлению
 с внутренним полем перехода,
 увеличивая высоту
 потенциального барьера
- $U_1 = U_k + U_{\text{ofp}}$



- Под действием обратного напряжения основные носители будут как бы отталкиваться от граничного слоя и дрейфовать вглубь полупроводника.
- При этом ширина слоя, обедненного основными носителями, увеличивается по сравнению с равновесным состоянием.
- Сопротивление p-n перехода для прохождения тока основных носителей увеличивается.
 Происходит изменение в соотношении токов через p-n -переход. Диффузионный ток уменьшается и в предельном случае с ростом потенциального барьера стремится к нулю (см. рис. б).



- ★ Для неосновных носителей заряда поле в p-n переходе остается ускоряющим, они захватываются им и переносятся через p-n переход. Процесс переноса неосновных носителей заряда через обратносмещенный p-n-переход в область полупроводника, где они становятся основными носителями, называется экстракцией.
- Дрейфовый ток, создаваемый неосновными носителями, называется тепловым током j_T. Так как концентрация неосновных носителей относительно мала, то и ток, образуемый ими, не может быть большим.

- Кроме того, он практически не зависит от величины поля в p-n-переходе, т.е. является током насыщения неосновных носителей. Все неосновные носители, которые подходит к p-n-переходу, совершают переход через него под действием поля, независимо от его величины. Поэтому ток j_T определяется только концентрацией неосновных носителей и их подвижностью.
- Концентрация неосновных носителей, а следовательно, и тепловой ток сильно зависят от температуры.

- По своему направлению тепловой ток противоположен току диффузии и поэтому результирующий ток p-n перехода равен
- * $j_{\text{обр}} = j_{\text{диф}} j_{\text{Т}}$
- f imes При $U_{
 m BH}\gg U_k$ током основных носителей заряда можно пренебречь. Поэтому тепловой ток $I_{
 m T}$ в этом случае называют током насыщения.
- Считается, что j_{обр} возрастает при уменьшении ширины запрещенной зоны полупроводника, из которой выполнен p-n переход.

- х Таким образом р−п-переход обладает вентильными свойствами.
- х 1. При приложении прямого смещения через переход протекает электрический ток, значение которого при повышении напряжения увеличивается по экспоненциальному закону. Сопротивление перехода минимально.
- Хари смещении р-п-перехода в обратном направлении его сопротивление возрастает, и через переход протекает малый тепловой ток.
- х Таким образом p−n переход обладает односторонней проводимостью, что используется при создании полупроводниковых приборов.